

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[9]ジエチルピフェニル [14]ジベンジルトルエン [16]水素化テルフェニル	<p>【水質】</p> <p>水質試料 1,000mL</p> <p>振とう抽出 塩化ナトリウム30g ヘキサン 100mL×2回</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 数mL</p> <p>溶解^{注1} ヘキサン 5mL</p> <p>カラムクリーンアップ Sep-Pak Classic Silica 溶出: 10%ジクロロメタン/ヘキサン溶液 10mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ^{注1} 窒素バージ 0.1mLまで 内標準添加 p-ターフェニル-d₁₄ 500ng/mL 10μL</p> <p>定容 0.1mL</p> <p>GC/MS^{注1}-SIM-EI^{注2}</p> <p>＜注＞次に示す方法を採用した例もあった。 1:カラムクリーンアップ前の溶解は行わず、カラムクリーンアップ後の濃縮を窒素バージのみで行った。また、測定機器としてGCはHP6890、MSはMAT95XL、カラムはDB-17ht(60m×0.32mm、0.15μm)を使用し([16])、GC/HRMS-SIM-EI([9]、[14]、[16])で測定した。 2:HRGC/HRMSで測定した。</p>	<p>＜分析原理＞ GC/MS^{注1}-SIM-EI^{注2}</p> <p>＜検出下限値＞ 【水質】(ng/L) [9] ※0.55 [14] ※1.4 [16] ※1.3</p> <p>※は同族体ごとの検出下限値の合計とした</p> <p>＜分析条件＞ 機器^{注1} GCMS-QP2010 カラム DB-5MS^{注1} 30m×0.25mm、0.25μm^{注1}</p>
「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠		

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[9]ジエチルピフェニル [14]ジベンジルトルエン [16]水素化テルフェニル	<p>【底質】</p> <p>底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)</p> <p>振とう抽出 アセトン 20mL</p> <p>遠心分離 3,000rpm、10分間</p> <p>3回繰り返す</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 2~3mL</p> <p>振とう抽出 3%塩化ナトリウム含有ヘキサン洗浄 水 100mL ヘキサン 10mL×2回</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 数mL</p> <p>溶解 ヘキサン 5mL</p> <p>カラムクリーンアップ 硝酸銀シカゲル 1g 洗浄: ヘキサン 10mL 溶出: シクロメタン 40mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 2~3mLまで</p> <p>溶解 ヘキサン 5mL</p> <p>カラムクリーンアップ Sep-Pak Classic Silica 溶出: 10%シクロメタン/ヘキサン溶液 10mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素バーン 0.1mLまで</p> <p>定容 0.1mL</p> <p>内標準添加 p-ターフェニル-d₁₄ 500ng/mL 10μL</p> <p>HRGC/HRMS</p>	<p><分析原理> HRGC/HRMS</p> <p><検出下限値> 【底質】(ng/g-dry) [9] ※0.53 [14] ※0.66 [16] ※0.35</p> <p>※は同族体ごとの検出下限値の合計とした</p> <p><分析条件> 機器 GCMS-QP2010 カラム DB-5MS 30m×0.25mm、0.25μm</p>
<p>「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠及び分析機関報告</p>		

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[9]ジェチルビフェニル [14]ジベンジルトルエン [16]水素化テルフェニル	<p>【底質】</p> <p>底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)</p> <p>振とう抽出 アセトン 20mL</p> <p>遠心分離 3,000rpm、10分間</p> <p>3回繰り返す</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレーター 2~3mL</p> <p>振とう抽出 3%塩化ナトリウム含有ヘキサン洗浄水 100mL ヘキサン 100mL 10分間</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレーター 数mL</p> <p>カラムクリーンアップ 硝酸銀シカゲル 1g 洗浄: ヘキサン 20mL(1回目)、10mL(2回目) 溶出: ジクロロメタン 40mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレーター 2~3mLまで</p> <p>カラムクリーンアップ Sep-Pak Classic Silica 洗浄: ヘキサン 20mL 溶出: 10%ジクロロメタン/ヘキサン溶液 10mL</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレーター 窒素パージ 1mLまで</p> <p>硫酸洗浄 濃硫酸1mLで 2、3回洗浄</p> <p>洗浄 精製水 5mL</p> <p>定容 ヘキサン 1mL</p> <p>GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>内標準添加 p-ターフェニル-d₁₄ 500ng/mL 10μL</p> <p>「平成18年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠及び分析機関報告</p>	<p><分析原理> GC/HRMS-SIM-EI</p> <p><検出下限値> 【底質】(ng/g-dry) [9] ※0.53 [14] ※0.66 [16] ※0.35</p> <p>※は同族体ごとの検出下限値の合計とした</p> <p><分析条件> 機器 GC: HP6890 MS: MAT95XL カラム DB-5MS 30m×0.25mm、0.25μm ([9]、[14]) DB-17ht 60m×0.32mm、0.15μm ([16])</p>